

2012年8月21日

### 株式会社日立ハイテクノロジーズとFEI Company間の特許侵害事件和解について

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：久田 眞佐男／以下、日立ハイテク）は、FIB装置\*に係る日立特許（以下、日立FIB特許）に関する特許紛争事件につき、米国FEI Company（以下、FEI社）との間で和解に至りました。

FEI社は日立ハイテクにより提起された多くの特許侵害事件を解決するべく、日立FIB特許のライセンス取得を希望しておりましたが、両社の協議の結果、日立ハイテクは和解可能な条件に至ったと判断し、FEI社に対しライセンスを許諾することに合意致しました。

本和解契約に基づき、日立ハイテクは本件に係る全ての特許訴訟・行政手続における請求を取下げます。また、本契約によりFEI社から15,000,000米国ドルが支払われます。尚、契約の枠組みはクロスライセンス契約です。その他の契約条件については公表を控えさせていただきます。

日立ハイテクは、知的財産権を極めて重要な経営資源と位置付けており、今後とも日立ハイテクの知的財産権が侵害されたと判断した場合には、毅然とした態度で臨んでいく所存です。

（ご参考）

\*FIB装置：集束イオンビーム(Focused Ion Beam)装置

#### 【報道関係問い合わせ先】

CSR 本部 コーポレート・コミュニケーション部 担当：松本、武内

TEL：03-3504-3258